



Beneq 社 / フィンランド

原子層堆積装置(ALD装置)

~ R&D装置から量産装置まで/各種アプリケーションに対応 ~



TFS 200



TFS 500



P400A/P800

特 徴

- 小サイズの試料から大型基板のバッチ処理まで各種アプリケーションに対応
- 各種プリカーサーソースが装着できるので、容易に各種実験が可能
(各種高温ソース:500度Cまで)
- プロセスチャンバー構造により、各種基板(3D、粉末、porous)対応
- 不活性ガスを利用したバルピングにより常にピュアな材料の供給
- 各種オプション :ロードロック、プラズマエンハンスALD、フローオプション(シャワーヘッド等)、パルスアシスト等

成膜例: 各種酸化膜、窒化膜、メタル膜、その他

Al₂O₃, Cr₂O₃, Co₂O₃, CuO, Fe₂O₃, Ga₂O₃, In₂O₃, Li₂O, MgO, NiO, SiO₂, Ta₂O₅, TiCrO_x, TiO₂, ZrO₂, HfO₂, V₂O₅ AlN, TiN, W_xN, TaN, PMDA-ODA, Pt,その他多数

株式会社マツボー

情報部門

TEL:03-5472-1723 / FAX:03-5472-1720